1. 기판 되장 ENOI N-Type 인 경우이 CUBIN V O NECOL.

gate bias 건안되건이 대는 accumulation,

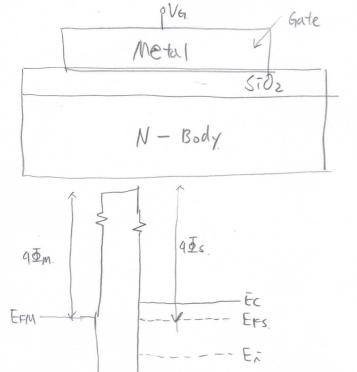
depletion, inversion 이 등 등 이 나이 보고 다니다

T장물 도시되어 전에서 보고 그 나는 최생기 EFM 19V

gate 건물이 인가되의 않은 토기 상태에서

flat band 국건을 한국하는 ideal cuse의

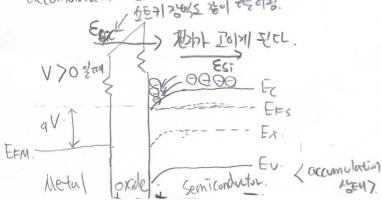
MOS Capacitor를 가장하다.

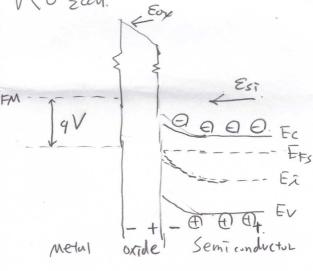


< flat band foru?

Metal Oxide Semi conductur

NType Body & Ec7 Ets 31 7170101 21-B3
Metalel EFMOI Chopped Earlbanding Elockl
accumulation ELL.



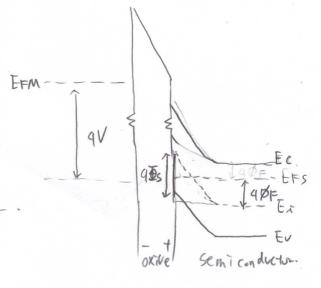


( de pletion SEY)

크기 양분 용건 단호 기사에 Ex Th banding 되 서 Ers 와 가까지 시계된다. inthinsic 상데지

07/14 BEYES HAME INVELSION of ELEI

V << 0 % ZW



 $\phi_{S}(inv) = 2 \phi_{F} = 2 \frac{kT}{q} ln \frac{N_{c}}{n_{x}}$   $h = n_{x} e^{\left(\frac{E_{F} - E_{x}}{kT}\right)}$ 

Eith Exs & Ithe hole of election

HILL Asolated DIST P-Type of ELZALE

INVELSION of SELL

(INVELSION 1064)